PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-210203

(43)Date of publication of application: 03.08.1999

(51)Int.CI.

B24C 1/04

B28B 11/08

(21)Application number: 10-018642

(71)Applicant: IG TECH RES INC

(72)Inventor: TAZAKI RYOICHI

(22)Date of filing:

30.01.1998

MATSUOKA TATSUHISA

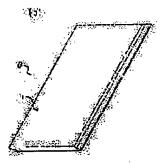
AKASHI SHIGERU

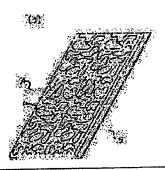
SUZUKI MASAHIKO

(54) DECORATIVE PANEL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form natural design on a decorative panel by rapidly heating a calcareous raw material obtained by molding powder and executing sand blasting after curing. SOLUTION: An inorganic molding B in which a calcareous raw material obtained by mixing stock is supplied to an extrusion molding machine, a press molding machine or the like to be molded is primarily cured and/or autoclave- cured. Next, a heat source is applied to the decorative face 1 of the inorganic molding B, when a decorative face is rapidly heated, the part of the decorative face 1 is cracked open and peeled in the size of e.g. depth of about 0.1-10 mm and width of about 0.1-tens mm to be pieces so as to be left, so that when the pieces are blown by a removing machine, irregular uneven patterns are produced on the decorative face 1. Furthermore, the patterns and characters are formed, a frosting pattern is given and the relief of the pattern is performed by colliding fine sand with the decorative face together with compressed air at high speed to be ground and performing sand blasting. When heated quickly, such a natural design as if a stone were cracked can be simply formed on the decorative face 1, and further an unprecedented decorative face 1 can be formed by executing sand blasting.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-210203

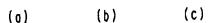
(43)公開日 平成11年(1999)8月3日

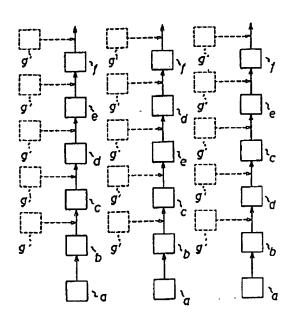
(51) Int.CL* E 0 4 F 13/14 B 2 4 C 1/04 B 2 8 B 11/08	酸別紀号 102	FI E04F 13/14 102C B24C 1/04 B B28B 11/08
	·	審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 7 頁)
(21)出顯番号 (22)出顧日	特顧平10-18642 平成10年(1998) 1 月30日	(71)出題人 000128333 株式会社アイジー技術研究所 山形県東根市大字蟹沢字上縄目1816番地の
		12 (72)発明者 田崎 良一 山形県東根市大字蟹沢字上縄目1816番地の 12 アイジー工業株式会社内
		(72)発明者 松岡 竜央 山形県東根市大字蟹沢字上縄目1816番地の 12 株式会社アイジー技術研究所内
		(72)発明者 明石 繁 山形県東根市大字蟹沢宇上縄目1816番地の 12 株式会社アイジー技術研究所内 最終頁に続く

(54) [発明の名称] 化粧パネル

(57)【要約】

[目的] 本発明は石灰質系素材を主成分とする原料を成形し、その後、養生、乾燥、等して製造する、外壁材、屋根材等の外装材、内装材、床材、天井材、間仕切り壁、等に使用する化粧パネルに関するものである。 【構成】 粉体を成形した石灰質系素材を急速加熱すると共に、養生後にサンドブラスト加工を施した化粧パネルAである。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 粉体を成形した石灰質系素材を急速加熱 すると共に、養生後にサンドプラスト加工を施すことを 特徴とする化粧パネル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は石灰質系素材を主成 分とする原料を成形し、その後、養生、乾燥、等して製 造する、外壁材、屋根材等の外装材、内装材、床材、天 井材、間仕切り壁、等に使用する化粧パネルに関するも 10 のである。

[0002]

【従来の技術】従来、との種化粧パネルを製造する装置 としては、押出機あるいはプレス成形機、等により所定 形状に成形し、その後、養生-乾燥する方法、等によっ て製造していた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、との種 装置により製造した化粧パネルの化粧面は平滑で、自然 の景観を出すことはできないものであった。また、機械 20 的に化粧面に模様を形成する方法、乾燥前の石灰質系素 材が柔らかい内に化粧面に模様を形成する方法、等も行 われているが、製品の流れ方向の模様しか形成できず、 自然の景観を出すことが難しかった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明はこのような欠点 を除去するため、粉体を成形した石灰質系素材を急速加 熱すると共に、養生後にサンドブラスト加工を施すこと により、自然なデザインを形成できる化粧パネルを提供 **. するものである。**

[0005]

[発明の実施の形態]以下に、図面を用いて本発明に係 る化粧パネルの一実施例について詳細に説明する。図1 (a)~(c)は本発明に係る化粧パネルを製造する装 置の代表的な例を示す概略説明図であり、原料供給工程 a、成形工程b、養生工程c、加熱兼加工工程d、サン ドブラスト加工工程を、乾燥工程がよりなるものであ ・り、図2(a)に示すように成形した無機成形体Bを図 2 (b) に示すような化粧パネルAとするものである。 [0006]なお、無機成形体Bよりなる化粧パネルA 40 としては、材質・製法区分では、セメントスラグ抄造 板、セメントスラグ系成形板、硬質木片セメント板、押 出成形セメント板、コンクリートパネル、等がある。 【0007】さらに詳説すると、原料供給工程aでは原 料(例えば、セメント、珪酸質系原料、骨材、水、等) を混練機を介して混合した石灰質系素材を、ベルトコン ベア等の供給機を介して真空押出成形機、あるいは真空 土旗押出成形機の一種からなる押出成形機等、あるいは ブレス成形機、等よりなる成形工程 b に供給するもので ある。

[0008]その石灰質系素材を主成分とする原料の一 例としては、セメント(石灰)、珪酸、珪酸カルシウ ム、補強繊維(ガラス繊維、ロックウール、石綿、木 片、パルプ、スラグ、シリカ、ビニロン、等)、骨材、 水、充填剤、等を用いるものであり、これらを各種割合 で混練したものである。

[0009] 養生工程 cは一次養生-オートクレーブ養 生、あるいはオートクレーブ養生、等であり、一次養生 は成形した無機成形体Bを倉庫等で養生し、次工程のオ ートクレーブ養生できる性状にするためのものである。 [0010]オートクレーブ養生(高圧蒸気養生)は、 高温(約180°C)、高圧(約10気圧)を加えて行う ものであり、無機成形体Bの石灰と珪酸の化学反応を促 進し、無機成形体Bを短時間(約24時間以内)で堅固 に硬化させるためのものである。 セメント製品、コンク リート製品を生産するためのものである。

【0011】加熱兼加工工程はは、その一例として示し た図2(a)に示す無機成形体Bに対し、図2(b)に 示すように表面加工を施すためのものであり、図3 (a)~(c) に示すような順序で加工が施されるもの

である。その方法としては、各種熱源Cにより、無機成 形体Bの化粧面lを急速加熱することにより、加工を施 すものである。

【0012】さらに詳細に説明すると、図3(a)に示 すように、熱源Cを無機成形体Bの化粧面1にあて、化 粧面1を急速に加熱すると、無機成形体Bの化粧面1部 分が0.1~10mm位の深さ、幅が0.1mmから数 十mm位の大きさで弾けて剥がれるものである。また、 その弾けて剝がれたかけら1a(厚さが0.1mmから 30 10mm位の大きさ、幅が0.1mmから数十mm位の 大きさ)が図3 (b) に示すように化粧面 1 上に残るた めに、かけら1aをエア、ブラシ等の除去機D(送風 機、回転ブラシ、移動ブラシ、吸引機(掃除機等)、 等) を介して吹き飛ばし、図3 (c)、図2 (b) に示 すように化粧面1に不規則な凹凸模様(石が割れたよう な模様、割石調、石積調、割肌調、等)を形成するもの

【0013】勿論、凹凸の深さ、大きさは熱源Cの種 類、温度、熱の噴射速度、無機成形体Bの素材、無機成 形体Bの含水%(石灰質系素材の吸着水、加熱兼加工工 程d前に化粧面lに散布する水等、等)等により左右さ れるものであり、これらを調整することにより、化粧面 1 に所望の凹凸模様を形成するものである。

【0014】熱源Cとしては、マイクロ波、遠赤外線、 レーザー、電磁波、LPガスバーナ、アセチレンパー ナ、等の一種、あるいは二種以上を組み合わせて使用す るものである。勿論、これら熱源Cは化粧面1を弾けて 剥がれさせる能力に設定し、使用するものである。な お、温度、噴射速度の関係でLPガスパーナ、アセチレ 50 ンパーナが表面加工には良好であり、先端の温度は18

00~2300℃位の高温である。

【0015】サンドブラスト加工工程eは、その一例と して示した図2 (b) に示す無機成形体Bの化粧面1に 対し、表面加工を施すためのものである。

【0016】さらに詳説すると、サンドプラスト加工工 程dは細かい砂を圧縮空気と共に、高速で被加工面(化 粧面1)に衝突させて、被加工面(化粧面1)を削るも のであり、砂の粗さ、吹き付ける速度、吹き付ける時 間、等を変えることによって石、セラミック、ガラス、 大理石、金属、等の表面を、掘ったり、荒らしたり、磨 10 す断面図である。 いたり、または部分的に覆ってブラストを行うことによ って模様の形成、文字形成、あるいは錆を除去したり、 艶消し模様を付けたり、模様の浮き彫りをしたりするも のである。また、砂と水を吹き付ける湿式方式と、乾い た砂を吹き付ける乾式方式があるものである。なお、 「サンドブラスト」は「砂吹き機」ともいう。

[0017] その形成は、一例として図4(a)~

(c) に示すような順序で加工が施されるものである。 図4(a)では、サンドブラストEで化粧面1に艶消し った砂を除去機D (図ではブロア) にて吹き払い、図4 (c) (図示しないが化粧面1に細かい凹凸が形成され ている) に示すように加工するものである。また、除去 機Dとして送風機の他に、回転ブラシ、移動ブラシ、吸 引機(掃除機等)、等を使用したり、これらを併用する こともできるものである。勿論、養生工程 c の後に加工 を施すために、加工性がよいものである。

【0018】乾燥工程 f は、赤外線ヒータ、逸赤外線ヒ ータ、マイクロ波加熱機、等の熱源によって無機成形体 Bの水分を0%(石灰質系素材の素材内に存在する水分 30 のである。 は残る)~5%位までに低減し、保形性を強化するため のものである。なお、乾燥工程!は赤外線ヒータ、マイ クロ波のみ、あるいは交互に、もしくは前段と後段のゾ ーンに分けて配設し、雰囲気を200~500℃位に生 地がクラックや変形を生じないような加熱曲線に対応し て加熱するものである。また、乾燥工程がは必要により 設けるものである。

【0019】勿論、乾燥工程fの前後には、施釉工程 (釉薬を固化する焼成工程を含む)、塗料塗布工程(乾 燥工程を含む)、等を形成でき、乾燥工程 f の後には梱 40 包工程、等の工程を形成できるものである。

【0020】なお、各工程間の一ヶ所、あるいは複数箇 所には図 $1(a)\sim(c)$ に点線で示すように、切断工 程gを形成し、所定の寸法に切断することができるもの である。

[0021] 切断工程gで使用する切断機としては、回 転刃(ダイヤモンドソー)、レーザー、水圧(ウォータ ージェット)、放電加工、刃物、ピアノ線、等により切 断し、定尺の無機成形体B(化粧パネルA)とするもの である。勿論、成形工程 b としてプレス成形機を用いた 50 マイクロ波加熱機等の乾燥工程 f で焼成し釉薬をガラス

場合には、切断工程gは使用しないものである。 【0022】また、これらの工程は連続して形成され、 素材から製品までを一貫した連続ラインで製造するもの である。

【0023】以上説明したのは、本発明に係る化粧パネ ルの一実施例にすぎず、図5 (a) ~ (e)、図6 (a)~(d)に示すように形成することができる。 [0024]図5 (a)~(e)、図6 (a)~(d) は無機成形体B(化粧パネルA)のその他の実施例を示

【0025】また、加熱兼加工工程d直前に、化粧面1 に水、湯等(H、Oを含むもの)を散布し、それが乾燥 する前に加熱兼加工工程dにより加工をすると、より弾 けて剥がれ易くなり、加工精度が向上し、深い凹凸、幅 広い凹凸、等も形成できるものである。

【0026】さらに、化粧面1に釉薬、有機物(塗料 等)、石油、シンナー、ワックス、等を散布した後に、 加熱兼加工工程dにより加工を施すこともできる。

【0027】勿論、各工程は必要により金属板、耐火レ 加工(模様等)を施し、図4(b)では化粧面1上に残 20 ンガ、等の遮蔽板で囲まれているが、特に加熱兼加工工 程dと除去機Dの工程はかけら1aによる粉塵が舞い上 がるために、吸引機等により粉塵を吸引し、外部に粉塵 が飛散しないようにするものである。

【0028】また、石灰質系パネル(窯業系サイディン グ)の他に、一般的な名称として、押出成形セメント 板、ALC(軽量気泡コンクリート)パネル、コンクリ ートパネル、等に加熱兼加工工程d、サンドプラスト加 工工程eにより加工を施すこともできるものである。勿 論、内部に中空を形成して軽量化を図ることもできるも

【0029】また、図7 (a) ~ (d) は化粧面1の平 面図であり、化粧面1に部分的にサンドブラスト加工を 施した化粧パネルAである。

【0030】図8 (a)、(b)は養生工程 dの後にサ ンドブラスト加工工程eを形成した工程示す概略説明図 である。

【0031】さらに、図9(a)~(c)は化粧被膜形 成工程hを形成した工程を示す概略工程図である。

[0032] 化粧被膜としての釉薬としては、例えば、 鉛釉、無鉛釉、錫釉、磁器釉、マジョリカ釉、炉器釉、・ プリストル釉、ロッキンガム釉、ゼーゲル磁器釉、生 釉、土釉、フリット釉、揮発釉、光沢釉、マット釉、ア ベンチュリン釉、結晶釉、ラスター釉、透明釉、不透明 釉等よりなり、化粧面 1 上に施釉するものであり、化粧 面1の保護 (コーティング) 材、化粧材、耐水材、耐久 材等として機能するものである。また、施釉の方法とし ては、スプレーガン、フローコーター等の一種よりなる 施釉機で上配釉薬を化粧面1上に一定厚さで塗布し、ガ ス、電気、石油、赤外線ヒーター、遠赤外線ヒーター、

状に硬化、定着させるものである。

[0033]また、釉薬の他に、化粧被膜として合成樹 脂分がフッ素樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、ポリ ウレタン樹脂、エボキシ樹脂、メラミン樹脂、アルキッ ド樹脂、メラミンアルキッド樹脂、ポリエステル樹脂、 ポリエーテル樹脂、フラン樹脂、ピニル樹脂、尿素樹 脂、マイレン酸樹脂、スチレン樹脂、ポリスチレン樹 脂、フェノール樹脂、オイルフリーポリエステル、スチ ・レン化アルキッド樹脂、アルミニウムペイント、チリメ ンエナメル、ビニル共重合体、ポリビニルブチラル、エ 10 チルセルロース等を用い、これに各種顔料、溶剤を加え た常温硬化型、加温硬化型、加熱硬化型、紫外線硬化 型、の合成樹脂系塗料でもよいものである。勿論、合成 樹脂のシートを熱融着、接着剤、等を介して形成しても よいものである。

[0034]図10(a)~(c)は研磨工程 i を形成 した工程を示す概略工程図である。

[0035]研磨工程iは養生工程cにより固化した化 粧パネルAの化粧面1を、先端にダイヤモンド研磨ホイ ルを装着した前後、左右、上下と立体的に移動可能なポ 20 リッシングマシンにより研磨し、化粧面1(一部分、頂 面のみ、等)を平坦化するものである。との場合には、 化粧面1がザラザラした面と水平面が存在するものとな る.

[0036]

【発明の効果】上述したように、本発明に係る化粧パネ ルによれば、①石が割れたような模様(割石調、石積 調、割肌調、等)で自然な化粧面を簡単に形成できる。 ②石が割れたような模様(割石調、石積調、割肌調、 等)の化粧面を人為的に形成できる。②サンドブラスト 30 A 化粧パネル 加工と、石が割れたような模様との相乗効果により、今 までにない化粧面を形成できる。の従来の装置に組み入 れるだけで形成できる。 D連続生産が可能である。 D装 習が簡単で、メンテナンスが容易である。 ②石灰質系バ ネルで石のような外観を形成できる。等の特徴、効果が ある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る化粧パネルを製造する工程の概略 を示す概略説明図である。

【図2】無機成形体の一例を示す説明図である。

【図3】加熱兼加工工程を示す説明図である。

【図4】化粧被膜形成工程後の無機成形体を示す説明図 である。

【図5】無機成形体と化粧パネルのその他の実施例を示 す断面図である。

【図6】無機成形体と化粧パネルのその他の実施例を示 す断面図である。

【図7】無機成形体と化粧パネルのその他の実施例を示 す平面図である。

【図8】本発明に係る化粧パネルを製造する工程のその 他の実施例を示す概略説明図である。

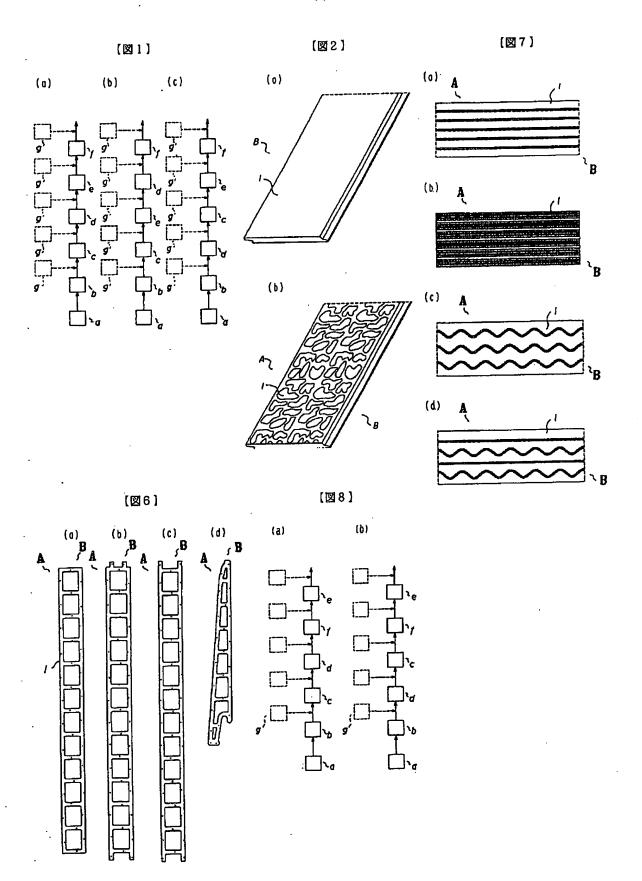
【図9】本発明に係る化粧パネルを製造する工程のその 他の実施例を示す概略説明図である。

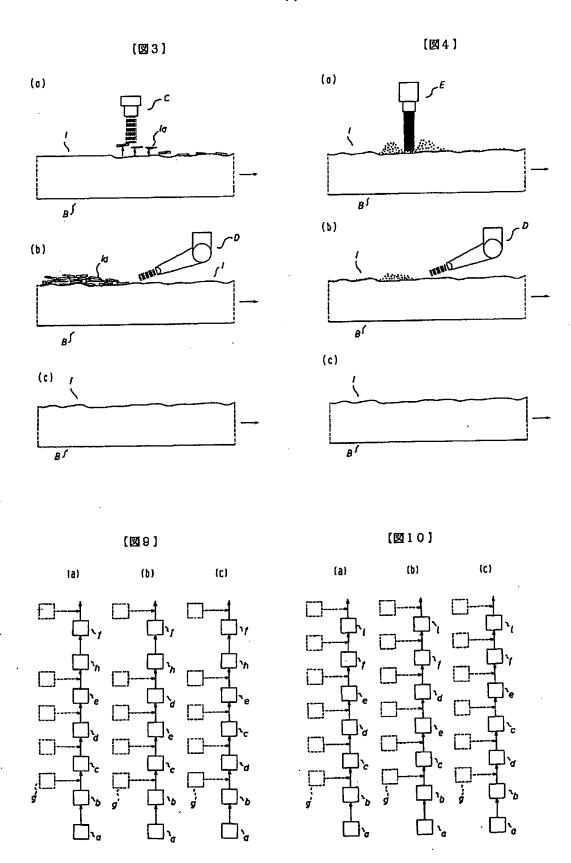
【図10】本発明に係る化粧パネルを製造する工程のそ の他の実施例を示す概略説明図である。

【符号の説明】

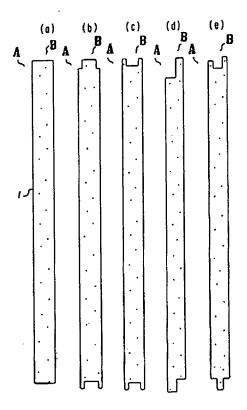
- a 原料供給工程
- b 成形工程
- c 養生工程
- d 加熱兼加工工程
- e サンドブラスト加工工程
- f 乾燥工程
- g 切断工程
- h 化粧被膜形成工程
- i 研磨工程
- - B 無機成形体

 - D 除去機
 - E サンドブラスト
 - 1' 化粧面
 - la かけら









フロントページの続き

(72)発明者 鈴木 雅彦

山形県東根市大字蟹沢字上縄目1816番地の 12 株式会社アイジー技術研究所内